

# 「卒業生等を通じた社会交流事業」 ホームカミングデー講演会のお知らせ

## シリコンウェーハ技術と LSIの進化

November 7, 2015

Isami Sakai

日時：2015年11月7日(土) 14:00～15:30

場所：広島大学先端研 401N講義室  
(東広島キャンパス先端物質科学研究棟 4階)

講演題目：「シリコンウェーハ技術とLSIの進化」

講師：酒井 勲美 氏

略歴：1980年：広島大学工学研究科修了(半導体工学研究室)  
日本電気に就職後、2007年(株)SUMCOに転職。CMOSプロセス、マイコン用Flash混載プロセス開発に従事。現在SUMCO社技術本部技術企画部担当部長。

どなたでも無料で参加できます。奮ってご来場ください。

主催：先端物質科学研究科、世話人：半導体集積科学専攻 横山 新

(内線6266, yokoyama-shin@hiroshima-u.ac.jp)